

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載
【部門区分】第 3 部門第 1 区分
【発行日】平成 17 年 10 月 27 日 (2005.10.27)

【公開番号】特開 2000-159511 (P2000-159511A)
【公開日】平成 12 年 6 月 13 日 (2000.6.13)
【出願番号】特願 平 10-329473
【国際特許分類第 7 版】

C 0 1 B 17/45

B 0 1 D 53/04

B 0 1 D 53/14

【 F I 】

C 0 1 B 17/45 G

B 0 1 D 53/04 E

B 0 1 D 53/14 A

【手続補正書】
【提出日】平成 17 年 7 月 28 日 (2005.7.28)
【手続補正 1】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】0 0 2 5
【補正方法】変更
【補正の内容】
【 0 0 2 5 】

図 3 の装置システムは、図 2 のものと同様であるが、ガス反応部 3 にはその内部の状況をモニタリングするためのインジケータ窓 9 を設けて処理操作の安全をはかっている。